

| 装置番号 | 装置名 | 設置場所 | 分類 | 機器利用 | | 技術補助 | | 技術代行 | |
|--------|-------------------------|-----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | バッチ課金 | 枚葉課金 | バッチ課金 | 枚葉課金 | バッチ課金 | 枚葉課金 |
| | | | | 円/処理 | 円/ウエハ | 円/処理 | 円/ウエハ | 円/処理 | 円/ウエハ |
| COL001 | ゲート金属スパッタ成膜装置（スパッタ装置A室） | 4Fクリーンルーム | 成膜装置 | | 2,500 | | 5,000 | | 5,000 |
| COL002 | 配線金属スパッタ成膜装置（スパッタ装置B室） | 4Fクリーンルーム | 成膜装置 | | 2,500 | | 5,000 | | 5,000 |
| COL003 | プラズマポリシリコン成膜装置 | 4Fクリーンルーム | 成膜装置 | | 2,500 | | 5,000 | | 5,000 |
| COL004 | プラズマ絶縁膜成膜装置 | 4Fクリーンルーム | 成膜装置 | | 2,500 | | 5,000 | | 5,000 |
| COL005 | 半導体酸化膜エッチング装置 | 4Fクリーンルーム | エッチング装置 | | 2,500 | | 5,000 | | 5,000 |
| COL006 | 金属エッチング装置 | 4Fクリーンルーム | エッチング装置 | | 2,500 | | 5,000 | | 5,000 |
| COL007 | アッシング装置（MAS装置A室） | 4Fクリーンルーム | エッチング装置 | | 2,500 | | 5,000 | | 5,000 |
| COL008 | 等方性エッチング装置（MAS装置B室） | 4Fクリーンルーム | エッチング装置 | | 2,500 | | 5,000 | | 5,000 |
| COL009 | 原子層堆積装置(ALD) | 4Fクリーンルーム | 成膜装置 | | 2,500 | | 5,000 | | 5,000 |
| COL010 | 自動洗浄装置 | 4Fクリーンルーム | ウェット処理装置 | | 2,700 | | 5,400 | | 5,400 |
| COL011 | 酸化炉（横型三段炉上段） | 4Fクリーンルーム | 熱処理装置 | 12,500 | | 25,000 | | 25,000 | |
| COL012 | 加熱炉（横型三段炉中段） | 4Fクリーンルーム | 熱処理装置 | 12,500 | | 25,000 | | 25,000 | |
| COL013 | 水素シンター炉（横型三段炉下段） | 4Fクリーンルーム | 熱処理装置 | 12,500 | | 25,000 | | 25,000 | |
| COL014 | 熱ポリシリコン成膜装置 | 4Fクリーンルーム | 成膜装置 | 12,500 | | 25,000 | | 25,000 | |
| COL015 | 熱窒化膜成膜装置 | 4Fクリーンルーム | 成膜装置 | 12,500 | | 25,000 | | 25,000 | |
| COL016 | 急速加熱装置(RTA) | 4Fクリーンルーム | 熱処理装置 | | 2,500 | | 5,000 | | 5,000 |
| COL017 | 電子線描画装置 | 4Fクリーンルーム | リソグラフィ装置 | | 10,500 | | 21,000 | | 21,000 |
| COL018 | レジスト塗布・現像装置 | 4Fクリーンルーム | ウェット処理装置 | | 2,700 | | 5,400 | | 5,400 |
| COL019 | マスクレス露光装置 | 4Fクリーンルーム | リソグラフィ装置 | | 10,500 | | 21,000 | | 21,000 |
| COL020 | エピタキシャル成長装置 | 3Fクリーンブース | 結晶成長装置 | | 19,500 | | 39,000 | | 39,000 |
| COL021 | フラッシュランプアニール装置(FLA) | 3Fクリーンブース | 熱処理装置 | | 2,500 | | 5,000 | | 5,000 |

バッチ課金：最大25枚まで同時に一括処理可能なバッチ式処理装置に対する課金

枚葉課金：ウエハ1枚ずつ処理を行う枚葉処理装置に対する課金

- (注1) 本年度は有償トレーニング制度は設けていませんが、次年度以降複数装置について設ける可能性があります。
- (注2) 技術代行はCOLOMODEスタッフが作業の代行を行います。成功を保証するものではありませんのでご注意ください。
- (注3) COLOMODEよりウエハの支給を受ける場合、別表1の通りの料金を申し受けます。
- (注4) COLOMODEの保有する分析装置・ドラフトチャンバーは、単独利用は不可となります。流動ロットの分析に用いる場合に限り、無償で利用可能です。
- (注5) 電子線描画装置およびマスクレス露光装置のデータ作成代行については、別表2の通りの料金を申し受けます。
- (注6) 独自のプロセスレシピを作成する場合、レシピをCOLOMODEに提供する場合に限り、作成に関わる装置利用料は無料です。
- (注7) 4インチウエハ以外のウエハを利用する場合、装置によっては別表3の装置設定切替作業代行費用の料金を申し受けます。
- (注8) COLOMODEスタッフが他施設（SCRなど産総研の他の共用施設）装置の技術代行を行う場合は、当該施設の定める機器利用料に加え、一律9,600円（税抜）を加算致します。

別表1 ウエハ料金表（税抜）

| 種別番号 | 種別 | 料金（円/枚） |
|------|-----------------|---------|
| W01 | バルクウエハ・レーザー刻印付き | 3,200 |
| W02 | SOIウエハ・レーザー刻印付き | 38,000 |
| W03 | バルクウエハ・基準マーク形成済 | 26,700 |
| W04 | SOIウエハ・基準マーク形成済 | 61,500 |

別表2 データ作成代行料金表（税抜）

| 装置番号 | 装置名 | 料金（円） |
|--------|-----------|--------|
| COL016 | 電子線描画装置 | 21,000 |
| COL018 | マスクレス露光装置 | 21,000 |

※ パターンファイルはGDSファイル渡し（ダイサイズ1cm角）

※ ダイ配置はCOLOMODE標準配置以外は不可

別表3 装置設定切替作業代行費用（税抜）

| 装置番号 | 装置名 | 料金（円） |
|--------|---------|--------|
| COL016 | 電子線描画装置 | 18,000 |

・課金係数について

ユーザーにより、機器利用・技術補助・技術代行の課金額に下記の係数が掛かります。

その他、支援形態によって課金額が変わることがございます。詳しくはCOLOMODEヘッドクォーターにお問い合わせください。

中小企業割引：中小企業（中小企業支援法第2条参照）による利用 0.5

研究規模割引：配賦総額が平均1000万円/年未満である競争的研究資金課題における利用 0.5

（※ 科学研究費助成事業データベースなどの公開情報が掲載されるホームページで判断可能な案件に限る）

上記割引に該当しない案件：1

・人頭経費について

本表記載事項の他に、来所して装置をご利用頂く場合、ユーザーのご所属により連携研究等経費算定要領別表第3に定める人頭経費を徴収させて頂いております。

詳細はCOLOMODEヘッドクォーターにお問い合わせください。